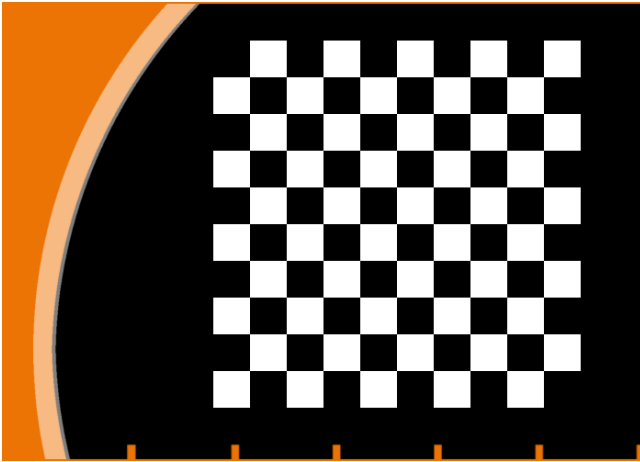


# Schachbrettmuster TC-CB100

Schachbrett mit  $100 \times 100 \mu\text{m}^2$  Quadraten



Dieses  $9.0 \times 9.0 \text{ mm}^2$  große Schachbrettmuster aus quadratischen  $100 \times 100 \mu\text{m}^2$  Feldern eignet sich insbesondere für die Prüfung von Verzeichnung und Bildfeldwölbung. Die sehr scharfen Kanten eignen sich aber auch zur Bestimmung der lokalen Abbildungsqualität.

(Abbildung schematisch)

Unsere hochauflösenden Testcharts sind mit hochpräziser E-Beam-Lithographie hergestellt. Als Träger dient ein Quarzsubstrat mit breiter spektraler Transmission (DUV-VIS-NIR), auf das eine Chromschicht hoher optischer Dichte aufgetragen ist. Die Teststrukturen werden durch die Abtragung der Chromschicht erzeugt, wobei Strukturgrößen bis zu 100 nm möglich sind und eine exzellente Maßhaltigkeit und Geradheit der Strukturkanten gewährleistet ist.

<b>Substrat</b>	<b>Quarzwafer (Fused Silica), 10mm x 10mm x 1 mm</b>
<b>Träger</b>	Objekträger-Format 75mm x 25mm x 1.5mm, Edelstahl mit Lasergravur
<b>Strukturierte Schicht</b>	Chrom, optische Dichte OD > 8@400nm / 6@550nm / 4.5@750nm / 3.6@1µm
<b>Struktur</b>	Schachbrettmuster $9.0 \times 9.0 \text{ mm}^2$ bestehend aus $90 \times 90$ Feldern der Größe $100 \times 100 \mu\text{m}^2$
<b>Maßhaltigkeit (max. Absolutfehler)</b>	100 nm/cm = $10^{-5}$
<b>Spektraler Transmissionsbereich</b>	200 nm – 2000 nm